



第73回トポロジカル物質科学セミナー Topological Materials Science Seminar (73)

Strong spin-orbit interaction in graphene induced by transition metal dichalcogenides

Dr. Taro WAKAMURA

University Paris-Saclay, France

Place: 教育研究棟4階 セミナー室2(407室), 東北大学マテリアル開発系

Date: August 20 (Monday), 2018

Time: 13:00-

Abstract:

内因的なスピinn軌道相互作用が極めて小さいグラフェンへの強いスピinn軌道相互作用の誘起は、スピントロニクスへの応用や、量子スピinnホール状態など新奇な物性の発現への期待から、近年盛んに研究が行われている。

本研究では、グラフェンと、グラフェンと同様の2次元層状物質で強い内因的スピinn軌道相互作用を持つ数種類の異なる膜厚の遷移金属二硫化物(TMD)のヘテロ構造を作製し、グラフェンへの強いスピinn軌道相互作用の誘起を試みた。

グラフェンに誘起されたスピinn軌道相互作用の大きさを評価するため、低温にて磁気抵抗効果の測定を行ったところ、グラフェンが強いスピinn軌道相互作用を持つ場合に観測される弱反局在効果が、異なるTMDを用いた全ての素子で観測された。

TMD上のグラフェンでは、グラフェンの面に対して対称と非対称の2種類のスピinn軌道相互作用が誘起されることが期待される。前者は特に量子スピinnホール状態を誘起可能な内因的スピinn軌道相互作用に関連し、後者は主にラシュバ型スピinn軌道相互作用に由来する。弱反局在効果の実験結果をより詳細に解析することにより、非対称成分に比べ対称成分が非常に大きいことが判明した。さらに、TMDとして単層のものを用いた方が、バルクを用いた場合よりも一桁以上大きいスピinn軌道相互作用が誘起されることが確認された。

グラフェンの面に対称なスピinn軌道相互作用には、内因的スピinn軌道相互作用に加え近年ヴァレー・ゼーマン(VZ)型と呼ばれる新たな型のスピinn軌道相互作用が提案されている。これら2つのスピinn軌道相互作用が異なるスピinn緩和機構を引き起こす点に着目し、支配的なスピinn緩和機構について調べたところ、特にディラック点近傍において、内因的スピinn軌道相互作用に関連する強いElliot-Yafet(EY)型のスピinn緩和の存在を確認した[1,2]。

References

- [1] Wakamura T. *et al.*, Phys. Rev. Lett. 120, 106802 (2018).
- [2] Wakamura T. *et al.*, to be submitted.